06;11 Фоточувствительность поверхностно-барьерных структур на основе Cu(In,Ga)Se₂ пленок, полученных вакуумным соиспарением

© В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, В.Ф. Гременок, Г.А. Ильчук

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург, Россия С.-Петербургский государственный политехнический университет, Россия Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Национальный университет "Львивська политехника", Львов, Украина E-mail: rudvas@spbstu.ru

Поступило в Редакцию 24 марта 2004 г.

Методом вакуумного соиспарения всех элементов получены поликристаллические пленки Cu(In,Ga)Se₂ с различным соотношением Cu, In и Ga. Ренттеновские исследования показали, что полученные слои являются однофазными и имеют высокоориентированную в направлении [112] структуру халькопирита. Пленки обладали зеркально-гладкой поверхностью с плотноупакованной структурой, состоящей из кристаллитов со средними размерами $0.1-0.3 \,\mu\text{m}$ и четкой огранкой. На основе полученных пленок созданы поверхностно-барьерные структуры типа (In, Ag)/Cu(In, Ga)Se₂ и исследованы спектральные зависимости квантовой эффективности фотопреобразования этих структур. Сделан вывод о возможности применения полученных структур для оптимизации процесса получения пленок CIGS.

Введение. Широкий класс тройных аналогов соединений II–VI, получаемый в результате замещения двух атомов II группы на атомы I и III групп, насчитывает более 30 полупроводников. Переход к исследованию тройных и более сложных соединений значительно расширяет возможности полупроводникового материаловедения. Среди этого класса материалов прямозонные полупроводники твердых растворов CuIn_xGa_{1-x}Se₂ (CIGS), обладающие высоким коэффициентом оптического поглощения ($\alpha > 5 \cdot 10^4$ cm⁻¹), стабильностью и радиационной стойкостью, признаны наиболее перспективными материалами для создания дешевых солнечных элементов (СЭ) [1,2]. Одновременное

21

напыление методом молекулярных пучков всех образующих эти растворы элементов (Cu, In, Ga и Se) позволило получить высококачественные пленки Cu(In,Ga)Se₂ и создать лабораторные тонкопленочные CЭ с рекордной эффективностью $\eta = 19.2\%$ [3]. Вместе с тем следует отметить, что фоточувствительность структур на основе пленок CIGS пока изучена достаточно слабо. Данная работа посвящена созданию фоточувствительных тонкопленочных структур, и в ней представлены первые результаты исследований фотоэлектрических свойств поверхностнобарьерных структур (In,Ag)/Cu(In,Ga)Se₂.

Получение тонких пленок Cu(In, Ga)Se₂. Тонкие пленки CIGS толщиной $1.3-1.5\,\mu$ m были получены вакуумным соиспарением всех элементов с различным соотношением Cu, In и Ga. Температура подложек в процессе осаждения CIGS составляла 400–420°С, давление в системе во время осаждения не превышало $(5-10) \cdot 10^{-6}$ mBar, а температура испарителя с селеном была 390°С. В качестве материала подложек во всех процессах осаждения использовалось обычное натрий-содержащее стекло с подслоем молибдена или без него в зависимости от назначения получаемых пленок.

Данные количественного анализа пленок Cu(In,Ga)Se₂ выявляют равномерное распределение элементов по поверхности с соотношением компонентов, приведенным в табл. 1 для двух типичных пленок. Рентгеновские исследования показали, что полученные слои являются однофазными и имеют высокоориентированную в направлении [112] структуру халькопирита. На дифрактограммах пленок наряду с типичной серией линий 112, 220/204, 312/116 и т.д. присутствуют рефлексы сверхрешетки 101, 103, 211 и наблюдается тетрагональное расщепление дублетов 116/312, что характерно для упорядоченной структуры халькопирита. Исследования морфологии поверхности пле-

Таблица 1. Элементный состав и электрические свойства пленок p-Cu(In,Ga)Se₂ при T = 300 K

Образец	Тип проводимости	$ ho, \Omega \cdot \mathrm{cm}$	Состав, at.%			
	пленки		Cu	In	Ga	Se
ZP3-4	р	$10^3 - 10^4$	26.75	22.23	5.36	45.47
ZP2	р	$10^8 - 10^{10}$	17.02	26.60	7.89	48.51



Рис. 1. Морфология поверхности (*a*) и поперечный скол (*b*) пленок Cu(In,Ga)Se₂. Увеличение составляет × 50 000.

нок были выполнены на растровом электронном микроскопе марки Stereoskan-360. Все полученные использованным методом осаждения пленки Cu(In,Ga)Se₂ обладали зеркально-гладкой поверхностью с плотноупакованной структурой (рис. 1, *a*), что свидетельствует о получении однофазного вещества, как это следует из рентгеновских исследований. Поперечный скол пленок показывает плотную структуру, состоящую из когерентно упакованных кристаллитов четкой огранки со средними размерами $0.1-0.3 \,\mu$ m (рис. 1, *b*). Направление роста кристаллитов ориентировано перпендикулярно плоскости подложек. Все полученные пленки Cu(In,Ga)Se₂ имели *p*-тип проводимости, а их удельное сопротивление ρ имеет выраженную тенденцию к понижению с увеличением содержания меди (табл. 1).



Рис. 1 (продолжение).

Поверхностно-барьерные структуры получены вакуумным термическим нанесением на поверхность пленок Cu(In,Ga)Se₂ чистого индия с толщинами $d \approx 0.05$ mm. Без какой-либо последующей термообработки структуры In/Cu(In,Ga)Se₂ обнаруживали выпрямление. Коэффициент выпрямления, определяемый из соотношения прямого тока к обратному при $U \approx 50$ V, в таких структурах обычно был невысоким и находился в пределах $K \approx 5-20$. Пропускное направление в полученных структурах обычно соответствовало положительной полярности внешнего смещения на пленке Cu(In,Ga)Se₂. Также аналогичным образом были получены структуры Ag/(CuIn,Ga)Se₂. Важно при этом отметить, что создание на поверхности пленок системы из пространственно разделенных поверхностно-барьерных структур с диаметром отдельной пленки около 0.7 mm на единой пленке Cu(In,Ga)Se₂ показало высокую локальную однородность фотоэлектрических характеристик



Рис. 2. Спектральная зависимость относительной квантовой эффективности фотопреобразования $\eta(\hbar\omega)$ (кривая *1*) и зависимость $(\eta\hbar\omega)^2 - \hbar\omega$ (кривая *2*) для структуры In/CuInGaSe₂ (Освещение со стороны барьерного контакта; T = 300 K; образец N₂ ZP2).

таких структур. Это служит основанием считать созданные пленки Cu(In,Ga)Se₂ достаточно однородными, что согласуется с данными их микрорентгеноспектрального анализа.

При освещении структур In/Cu(In,Ga)Se₂ генерируется фотонапряжение и пленка CIGS, как правило, имеет положительную полярность. При этом знак фотонапряжения не зависит от геометрии освещения структур и энергии падающих фотонов. Максимальная вольтовая фоточувствительность лучших из полученных структур составляла $S_U^m \approx 10^3 \text{ V/W}$ при T = 300 K и достигалась, как правило, при их освещении со стороны барьерных слоев.

На рис. 2 (кривая 1) представлена типичная для поверхностнобарьерных структур In/Cu(In,Ga)Se₂ и Ga/Cu(In,Ga)Se₂ спектральная

Таблица 2. Фотоэлектрические свойства структур на пленках *p*-CuInGaSe₂ (ZP2) при T = 300 K

Структура	S_U^m , V/W	$\hbar\omega^m$, eV	E_G , eV
In/p-CuInGaSe ₂	1000	1.3-2.7	1.10
Ag/p-CuInGaSe ₂	350	1.3-2	1.10

зависимость относительной квантовой эффективности фотопреобразования $\eta(\hbar\omega)$. Из рис. 2 следует, что при $\hbar\omega > 0.95$ eV в этих структурах наступает экспоненциальный рост η , которому отвечает крутизна $S = \delta(\ln \eta) / \delta(\hbar\omega) \approx 29 \text{ eV}^{-1}$. Согласно [4], такая высокая крутизна позволяет высказать предположение о проявлении прямых межзонных оптических переходов, что соответствует сведениям, полученным ранее для объемных монокристаллов твердых растворов Cu(In,Ga)Se₂ [3,5].

Обычно при энергиях фотонов $\hbar\omega \approx 1.10 \,\text{eV}$ в спектрах $\eta(\hbar\omega)$ полученных поверхностно-барьерных структур экспоненциальная зависимость фоточувствительности переходит в параболическую, а при $\hbar\omega > 1.3\,\mathrm{eV}$ фоточувствительность вплоть до $\hbar\omega \approx 2.8\,\mathrm{eV}$ остается практически неизменной и сохраняется на максимальном уровне. Как следует из рис. 2 (кривая 2), длинноволновый край фоточувствительности барьеров Шоттки In/Cu(In,Ga)Se₂ в координатах $(\eta \hbar \omega)^2 - \hbar \omega$ линеаризуется, что, согласно [4], позволяет считать межзонные переходы в таких пленках прямыми, а путем экстраполяции этой зависимости $(\eta \hbar \omega)^2 \rightarrow 0$ определить ширину запрещенной зоны полученных пленок $E_G \approx 1.10 \, {\rm eV}$ при $T = 300 \, {\rm K}$. Эта величина оказалась несколько выше ширины запрещенной зоны для позиционно-упорядоченного стехиометрического соединения CuInSe₂ [5], что связано с образованием в процессе получения твердых растворов. Аналогичные результаты были получены и при исследованиях спектров фоточувствительности структур Ag/Cu(In,Ga)Se₂. Для полученных структур характерной оказалась широкая спектральная область максимальной фоточувствительности $\Delta \hbar \omega^m$ (табл. 2).

Заключение. В целом полученные результаты демонстрируют возможности использования процесса соиспарения для формирования фоточувствительных структур на пленках твердых растворов Cu(In,Ga)Se₂. С другой стороны, исследования фоточувствительности экспрессно со-

здаваемых на пленках Cu(In,Ga)Se₂ поверхностно-барьерных структур могут найти применение для оптимизации процесса получения тонких пленок CIGS.

Работа выполнена при поддержке гранта ИНТАС 2001-283.

Список литературы

- [1] Коутс Т., Микина Дж. Современные проблемы полупроводниковой фотоэнергетики. М.: Мир, 1988. 307 с.
- [2] Kazmerski L. // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 1997. V. 1. N 1, 2. P. 71–87.
- [3] Rau U, Shock H.W. // Series on Photoconversion of Solar Energy. 2001. V. 1. P. 277–280.
- [4] Панков Ж. Оптические процессы в полупроводниках. М.: Мир, 1973. 273 с.
- [5] Coutts T.J., Kazmerski L.L., Wagner S. Copper Indium Diselenide for Photovoltaic Applications. Amsterdam: Pergamon Press, 1986. 427 p.